# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP403274161A

PAT-NO: JP403274161A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03274161 A

TITLE: MANUFACTURE OF NOZZLE PLATE FOR INK JET

PUBN-DATE: December 5, 1991 INVENTOR-INFORMATION:

**NAME** 

MIYASAKA, YOSHIYUKI

ATOBE, MITSUAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

N/A

APPL-NO: JP02074107 APPL-DATE: March 23, 1990

INT-CL\_(IPC): B41J002/135

US-CL-CURRENT: 29/890.1,347/47

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a nozzle hole from deforming, clogging, etc., by a method wherein a metallic film is patterned in a shape of a nozzle plate for ink jet on a substrate composed of nonmetallic materials, and plating is processed on the metallic film.

CONSTITUTION: A Cr metallic film 2 and then a Cu metallic film 3 are successively formed by vapour deposition on a surface of a glass substrate 1 being nonmetallic material. A positive resist is spin-coated and is prebaked with a hot plate at 80° C. When a nozzle hole of a nozzle plate and a negative-positive reversal form are exposed and developed by using a photomask, a patterned positive resist 4 is obtained. Then, when the positive resist 4 is removed by resist peeling solution, a Cr metallic film 2 and a Cu metallic film 3f are patterned in a shape of a nozzle plate on the glass substrate 1 composed of nonmetallic material. A peeling layer 5 is formed on the Cu metallic film 3 by chromate treatment. A Ni film is formed by a required thickness by an electrolytic plating or an electroless plating, and a nozzle plate 6 is separated from the peeling layer 5.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

①特許出願公開

### ② 公開特許公報(A) 平3-274161

⑤Int. Cl. 5

. :

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月5日

B 41 J 2/135

9012-2C B 41 J 3/04

103 N

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②特 願 平2-74107

②出 願 平2(1990)3月23日

⑫発 明 者 宮 坂 善善 之 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

会社内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 紐 提

1. 発明の名称

インクジェット用ノズルブレートの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

電解メッキ法又は、無電解メッキ法により形成され、インクジェットブリンター等に使用されるインクジェット用ノズルブレートにおいて、非金属材料からなる基板上へ、前記、インクジェットの形状に金属膜をバターニングし、前記、金属膜上へメッキを施すことにより、前記、インクジェット用ノズルブレートの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、複写機やコンピューター、ファック ス等の外部出力装置に利用される、インクジェッ トプリンター用ノズルブレートの製造方法に関する.

#### 〔従来の技術〕

従来の技術としては、第2図に示すように、銅 版・ステンレス板・Bs板等の金属から成る基板 21上に、フォトレジスト法や印刷法を用いてノ ズルプレートのノズル孔の形状にレジスト22を パターニングし、その後、基板21の表面へ、ク ロメート法や酸化法により剥離皮膜23を形成し てから電解メッキ法(電鋳)あるいは無電解メッ キ法によりノズルブレート24を形成し、ノズル ブレート24を基板21から離型して第3図のよ うなノズルブレートとする製造方法が知られてい た。又、他の従来技術としては、平坦性の優れた ノズルブレートを得るために、第4図に示すよう に、セラミックス・ガラス等の非金属から成る基 板25の表面を、蒸着・スパッタ・無電解メッキ 等の方法により N i あるいは、N i / C r 等の金 属膜26を形成することにより非金属から成る基 板25の表面を電鋳や無電解メッキが可能な金属

-377-

化処理して、以降は前記、第2図の説明と同様に ノズルブレートのノズル孔の形状にレジスト22 をパターニングし、その後基板26の表面へ剥離 皮膜23を形成してから電解メッキ法(電鋳)あ るいは無電解メッキ法によりノズルブレート24 を形成し、ノズルブレート24を基板21と金属 膜26から離型して第3図のようなノルズブレートとする製造方法も知られていた。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかし、かかる従来のインクジェット用ノバレジストの製造方法は、パターニングされたレジスト22中のピンホール、クラック・チリ等でに入れることができずしたの中に異常成長による穴変形が発生生したり、長時間のメッキ中にレジスト22が剥離をれり、長時間のメッキ中にレジスト22が剥離を常れり、大いの月ブレートに24~200穴のノバルれが形成され、近年、ブリントの高速化に伴いよりよりであったの製造においてはノズルれが1次でもの製造においてはノズルれが1次でもれてはノズルカジュートの製造においてはファックを

する。第1回は、本発明のインクジェット用ノズ ルプレートの製造工程を示す図であり、第1図 (a) において、非金属材料であるガラス基板 1 の表面にCェ金属膜2を0.01μm厚み、Cu 金属膜3を0.1 μm厚み、蒸着により順次形成 する。尚、Cェ金属腹2はガラス基板1とCu金 属膜3の密着力を向上させるために形成する。次 に、第1図(b)に示すように、フォトリソ法に より、ポジレジストを1μm厚みにスピンコート して、80℃のホットプレートで1分プレベーク し、ノズルブレートのノズル孔とネガポジ逆の形 状にフォトマスクを用いて露光、現像すると、パ ターニングされたポジレジスト4が得られる。そ の後、第1図(c)のように、2%過硫安溶液で Cu金属膜3をエッチングし、続けてCr金属膜 2 を 1 0 % 赤血塩 + 5 % K O H 溶液でエッチング する。次いで、ポジレジスト4をレジスト剥離液 で除去すると、第1図(d)に示したように、非 金属材料からなるガラス基板1の上にCェ金属膜 2 と C u 金属膜 3 が ノ ズルブレートの形状に パタ

目づまり等の欠陥があれば全て不良となるため、 品質低下とコストアップの問題点を有していた。

そこで、本発明は従来のこのような問題点を解決するため、ノズル孔の穴変形と目づまりのない 製造方法により高品質、低コストのインクジェット用ノズルブレートを提供することを目的としている。

#### 〔課題を解決するための手段〕

上記課題を解決するため、本発明のインクジェット用ノズルブレートの製造方法は、電解メッキ法又は、無電解メッキ法により形成され、インクジェットブリンター等に使用されるインクジェット用ノズルブレートにおいて、非金属材料からなる基板上へ、前記、インクジェット用ノズルブレートを形成したことを特徴とする。

#### 〔実 施 例〕

以下に本発明の実施例を図面にもとづいて説明

ーニングされる。さらに、第1図(e)に示すようにCu金属膜3の上にクロメート処理により、剥離層5を形成する。次に、第1図(f)のように、電解メッキ法(電鋳)、又は、無電解メッキ法によりNi皮膜を所望の厚み、例えば100μm形成しノズルブレート6を得る。その後、ノズルブレート6を剥離層5より離型すると第1図(g)に示したノズルブレート6となる。

以上の実施例において得られたノズルブレート 6 は、非金属材料であるガラス基板1の上に直接、金属膜であるCr金属膜1とCu金属膜2が 形成されていて、メッキ工程中にはレジストが使 用されていないため、メッキ液中にレジストが浸 漬することがないのでレジストの剥離、ピンホー ル、クラック、チリ等の影響を受けることがな い。その結果、ノズルブレート6ノズル孔の穴変 型や目づまりを防止することができる。

第 5 図は、本発明の他の実施例を示すインクジェット用ノズルブレートの製造工程を示す図であり図面に基づいて説明する。第 5 図 (a) にお

いて、非金属材料であるセラミックス基板51の 表面にCT金属膜52を0.01μm厚み、Ni 金属膜53を0.1μm厚み、スパッタにより順 次形成する。尚、Cr金属膜52はガラス基板5 1と、Ni金属膜53の密着力を向上させるため に形成する。次に、第5図(b)に示すように、 フォトリソ法によりポジレジストを1μm厚みに スピンコートして、80℃のホットプレートで1 分間プレベークし、ノズルブレートのノズル孔と ネガポジ逆の形状にフォトマスクを用いて露光、 現像すると、パターニングされたポジレジスト5 4が得られる。その後、第5図(c)のように、 塩化第2鉄溶液でNi金属膜53をエッチング し、続けてCェ金属膜52を10%赤血塩+5% KOH溶液でエッチングする。次いで、ポジレジ スト54をレジスト剝離液で除去すると、第5図 (d) に示したように非金属材料からなるガラス 基板51の上にCr金属膜52とNi金属膜53 がノズルブレートの形状にパターニングされる。 さらに、第5図(e)に示すようにNi会属膜5

3の上に熱酸化皮膜処理により、剥離磨55を形 成する。次に、第5図(f)のように、電解メッ キ法 (電鋳)、又は、無電解メッキ法によりNi 皮膜を所望の厚み、例えば100μm形成しノズ ルプレート56を得る。その後、ノズルプレート 56を剥離層55より離型すると第5図(g)に 示したノズルプレート56となる。

以上の実施例において得られたノズルブレート 56 も、非金属材料であるセラミックス基板 5 1 の上に直接、金属膜であるCェ金属膜51とNi 金属腹52が形成されていて、メッキ工程中には レジストが使用されていないため、メッッキ液中 にレジストが没潰することがないのでレジストの 剥離、ピンホール、クラック、チリ等の影響を受 けることがない。その結果、ノズルブレート56 ノズル孔の穴変型や目づまりを防止することがで きる。又、セラミックス基板はガラス基板に比べ て高強度のため、ノズルブレートを離型する時、 傷がつかないので繰り返し使用できるという効果 もある。

#### [発明の効果]

本発明のインクジェット用ノズルブレートの製 より、ノズル孔の穴変形や目づまりを防止するこ

実施例による、インクジェット用ノズルブレート の製造工程を示す縦断面図。

造方法は、以上説明したように、非金属材料から なるカラスやセラミックス等の基板の上にCuや Ni等の金属腹を直接ノズルブレートの形状にバ クーニングし、メッキ液中にメッキ液に弱いレジ ストが直接浸漉されないという簡単な製造方法に とが可能となり、高品質、低コストのインクジェ ット用ノズルプレートを得ることができる。又、 そのために生産性も大きく向上するという効果が ある.

### 1・・・ガラス基板

2 · · · Cr金属膜

3 · · · C u 金属膜

4 · · ・ポジレジスト

5・・・剥離層

6 ・・・ノズルブレート

51・・・セラミックス基板

5 3 · · · N i 金属膜

5 4 ・・・ポジレジスト

55・・・剥離層

56・・・ノズルブレート

#### 以上

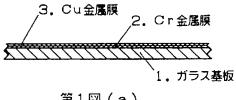
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~第1図(g)は、本発明のイン クジェット用ノズルプレートの製造工程を示す縦 断面図。

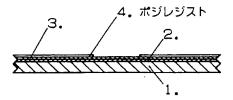
第2図~第4図は、従来のインクジェット用ノ ズルブレートの製造工程を示す機断面図。

第5図(a)~第5図(g)は、本発明の他の

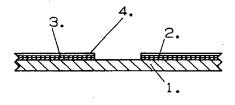
出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴 木 喜三郎(他)名)



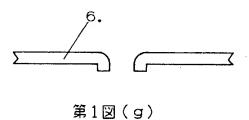
第1図(a)

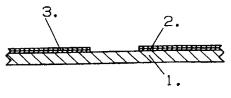


第1図(b)

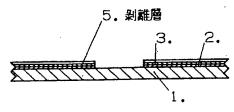


第1図(C)

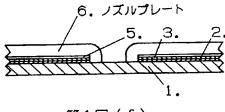




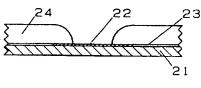
第1図(d)



第1図(e)



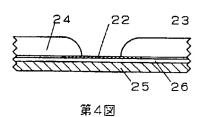
第1図(f)



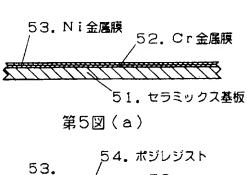
第2図

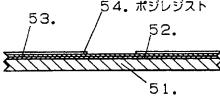


第3図

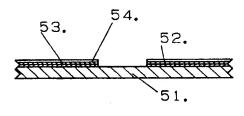


-380 -



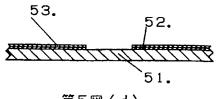


第5図(b)

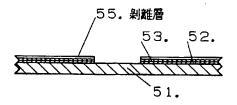


第5図(C)

9



第5図(d)



第5図(e)

